MOCVD

Metal Organic Vapor Deposition, Metallorganische Gasphasenabscheidung

MO CVD ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem metallorganische Ausgangsverbindungen durch chemische Reaktionen aus der Gasphase an die Oberfläche eines erhitzten Substrats abgeschieden werden.

Die MO-CVD Anlage wurde ebenfalls im Rahmen von studentischen Laborprojekten aufgebaut und in Betrieb genommen.

